

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成22年9月9日(2010.9.9)

【公表番号】特表2009-545774(P2009-545774A)

【公表日】平成21年12月24日(2009.12.24)

【年通号数】公開・登録公報2009-051

【出願番号】特願2009-522994(P2009-522994)

【国際特許分類】

G 03 F 7/20 (2006.01)

H 05 K 3/06 (2006.01)

H 05 K 3/18 (2006.01)

H 05 K 3/00 (2006.01)

【F I】

G 03 F 7/20 501

H 05 K 3/06 E

H 05 K 3/18 J

H 05 K 3/00 G

【手続補正書】

【提出日】平成22年7月21日(2010.7.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

フォトトレジスト層を有する誘電体基板を提供することと、

フォトイメージングマスクを通して前記フォトトレジストの第1部分を紫外線に露光することと、

前記誘電体基板を前進させること、及び前記フォトイメージングマスクを通して前記フォトトレジストの第2部分を紫外線に露光することと、を含む方法であって、前記フォトトレジストの前記第2部分が、前記フォトトレジストの前記第1部分と部分的に重なり合い、並びに

前記フォトイメージングマスクが、配列される回路の区域のパターンを有する、方法。

【請求項2】

前記誘電体基板を2度目に前進させること及び前記フォトイメージングマスクを通して前記フォトトレジストの第3部分を紫外線に露光することを更に含み、前記フォトトレジストの前記第3部分が、フォトトレジストの前記第2部分と部分的に重なり合う、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

フォトイメージングマスクの長軸に対してある角度をなして配置される複数個の回路セグメントを含むパターンを有する前記フォトイメージングマスクを有する、物品。